

装置名	主要な機能 や仕様	その他 特記事項	利用条件			担当者(内線) 研究室名	詳細情報 (ページ)
			利用形態	運転・保守費用 の概略	その他 条件		

I. 試料の形成・加工・処理のための装置

1-1. 機械加工・研磨・4D成形など

高速精密旋盤						工作実習工場	
高速精密旋盤						工作実習工場	
高速精密旋盤						工作実習工場	
放電加工機						工作実習工場	
ダブルストローラヘッダー						工作実習工場	
2目的精密研削盤						工作実習工場	
小型NCフライス盤他						工作実習工場	
ワイヤー放電加工機						工作実習工場	
超高真空摩擦試験機						機械創成	
3次元測定器						固体力学	
超微細レーザ加工装置						光機能物質	
放電プラズマ焼結機						材料プロセス	
クロスセクションポリッシャ						情報記録機能材料	
集束イオンビーム加工機						半導体	
集束イオンビーム加工観察装置						情報記録機能材料	

1-2. マイクロ・ナノ構造形成用プロセス

多成分クラスターイオン生成装置						クラスター	
イオン銃						クラスター	
マイクロビームイオン銃(液体金属イオンガンシステム)						表面科学	
DRIE装置						マイクロメカトロニクス	
パターン発生形成装置						クリーンルーム	
ナノ構造半導体形成装置						ナノ電子工学	
電子線描画ステージ						情報記録機能材料	
多元レーザー蒸着装置						情報記録機能材料	
薄膜試料用マグネトロンスパッタ装置						フロンティア材料	
スパッタ装置・RF仕様						界面制御プロセス	
高真空薄膜作成装置						界面制御プロセス	
真空蒸着装置						半導体	
多機能薄膜作成装置						情報記録機能材料	
特殊改良型イオンビームスパッタ装置						情報記録機能材料	
バッチ式スパッタリング装置						半導体	
分子線エピタキシー(MBE)装置						半導体	
反射防止膜成膜実験装置						半導体	
CVD装置						マイクロメカトロニクス	
常圧CVD装置						半導体	
ケミカルビームエピタキシー(CBE)装置						半導体	
光機能導波路素子作製装置						光機能物質	
スクリーン印刷機						半導体	
電極印刷機						半導体	
有機半導体薄膜作製装置						量子界面物性	
量子界面構造作製装置						量子界面物性	

1-3. 化学合成・加熱処理・真空処理など

クラスター温度制御装置						クラスター	
拡散炉(1)						半導体	
拡散炉(2)						半導体	

装置名	主要な機能 や仕様	その他 特記事項	利用条件			担当者(内線) 研究室名	詳細情報 (ページ)
			利用形態	運転・保守費用 の概略	その他 条件		
シリコンウェハー熱処理装置						ナノ電子工学	
雰囲気可変高温電気炉						フロンティア材料	
雰囲気可変型加熱装置						半導体	
温度勾配器						フロンティア材料	
高速熱処理装置						半導体	
加熱装置						半導体	
シリコン結晶成長炉						半導体	
単結晶育成装置						光機能物質	
光散乱測定用高温炉						フロンティア材料	
FCVD装置加熱炉						フロンティア材料	
先端フォトリソ材料製造装置						フロンティア材料	
真空活性ガス雰囲気熱処理炉						材料プロセス	
低温5軸試料台付超高真空チャンバー						表面科学	
ターボ分子ポンプ						クラスター	

1-4. その他

TALIS用マニピュレータ						表面科学	
CNC三次元座標測定機						工作実習工場	
洗浄ドラフト(無機ドラフトPre-Clean)						半導体	
洗浄ドラフト(SDE+TEX)						半導体	
洗浄ドラフト(角洗浄槽付)						半導体	